Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Espectrofotometro de absorcion atomica llama/GFAA 185-900 nm

Código: B2-01-012040.1 / B2-01-012040.2 / B2-01-012040.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La versión de sistema de llama es un espectrofotómetro de absorción atómica de llama dedicado; las versiones de sistema integrado de llama y GFAA combinan las tecnologías de atomización por llama y por horno de grafito. Estos instrumentos se utilizan en monitoreo ambiental, ensayos de inocuidad alimentaria y análisis metalúrgico para la determinación de elementos traza y mayoritarios.

Características

1. Sistema óptico de reflexión total para la relación señal-ruido del instrumento.
2. Ocho posiciones de lámpara con diseño de rotación de 360°.
3. Software de estación de trabajo bajo el sistema MS Windows, de operación automática y completa.
4. Funciones QA/QC: en cada ensayo se entregan la desviación estándar (SD) y la desviación estándar relativa (RSD) de la absorbancia, junto con la SD y la RSD de la concentración calculada; la curva de trabajo de las muestras patrón verifica automáticamente el coeficiente de correlación.
5. Medición de información completa: cada medición guarda los resultados de distintos métodos de procesamiento de datos (promedio, altura de pico, área de pico y resultados estadísticos) para el análisis del usuario.
6. Base de datos de un clic que completa rápidamente ajustes como longitud de onda, ancho de banda espectral, corriente de la lámpara, alto voltaje negativo y balance de energía.
7. Método de calentamiento del horno de grafito: calentamiento longitudinal del horno de grafito (mantiene uniforme la temperatura de la fase gaseosa dentro del tubo de grafito, permite que la muestra alcance la temperatura de atomización de forma simultánea e instantánea, mejora la eficiencia de atomización y la exactitud de la medición, reduce los requisitos de desempeño del cuerpo del horno y prolonga su vida útil) (sólo en las versiones de sistema integrado de llama y GFAA).

Especificaciones técnicas

Especificación	±0.15nm - Sistema de llama B2-01-012040.1	±0.2nm - Sistema integrado de llama y GFAA B2-01-012040.2	±0.15nm - Sistema integrado de llama y GFAA B2-01-012040.3
Tipo de instrumento	Sistema de llama	Sistema integrado de llama y GFAA	Sistema integrado de llama y GFAA
Sistema óptico · Tipo de haz	Doble haz	Doble haz	Doble haz
Sistema óptico · Red de difracción	Surcos 1800líneas/mm, longitud de onda de blaze 250nm	Surcos 1800líneas/mm, longitud de onda de blaze 250nm	Surcos 1800líneas/mm, longitud de onda de blaze 250nm
Sistema óptico · Rango de longitud de onda	185~900nm	185~900nm	185~900nm
Sistema óptico · Ancho de banda espectral	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm	0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm
Sistema óptico · Exactitud de longitud de onda	±0.15nm	±0.2nm	±0.15nm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	±0.15nm - Sistema de llama B2-01-012040.1	±0.2nm - Sistema integrado de llama y GFAA B2-01-012040.2	±0.15nm - Sistema integrado de llama y GFAA B2-01-012040.3
Sistema óptico · Repetibilidad de longitud de onda	≤0.05nm	≤0.1nm	≤0.05nm
Sistema óptico · Desviación del ancho de banda espectral	±0.02nm	±0.02nm	±0.02nm
Sistema óptico · Portalámparas	8(Admite precalentamiento simultáneo de 1~4 lámparas)	8(Admite precalentamiento simultáneo de 1~4 lámparas)	8(Admite precalentamiento simultáneo de 1~4 lámparas)
Desempeño fotométrico · Modos de lectura	Transmitancia, absorbancia, concentración	Transmitancia, absorbancia, concentración	Transmitancia, absorbancia, concentración
Desempeño fotométrico · Rango fotométrico	0~125%T, -0.1~3.00Abs	0~125%T, -0.1~3.00Abs	0~125%T, -0.1~3.00Abs
Desempeño fotométrico · Estabilidad de línea base	Deriva ±0.002Abs(Estable 30min) Deriva ±0.004Abs(Dinámica 15min)	Deriva ±0.003Abs(Estable 30min) Deriva ±0.005Abs(Dinámica 15min)	Deriva ±0.002Abs(Estable 30min) Deriva ±0.004Abs(Dinámica 15min)
Desempeño fotométrico · Capacidad de corrección de fondo	Lámpara de deuterio: ≥40 veces(a 1Abs) Autoinversión: ≥80 veces(a 1Abs)	Lámpara de deuterio: ≥40 veces(a 1Abs)	Lámpara de deuterio: ≥40 veces(a 1Abs) Autoinversión: ≥80 veces(a 1Abs)
Análisis por llama · Concentración característica	Método de llama para Cu: ≤0.02μg/mL	Método de llama para Cu: ≤0.035μg/mL	Método de llama para Cu: ≤0.02μg/mL
Análisis por llama · Límite de detección	Método de llama para Cu: ≤0.004μg/mL	Método de llama para Cu: ≤0.006μg/mL	Método de llama para Cu: ≤0.004μg/mL
Análisis por llama · Repetibilidad	Método de llama para Cu: ≤0.5%	Método de llama para Cu: ≤0.6%	Método de llama para Cu: ≤0.5%
Análisis por llama · Quemador	Cabezal de quemador de titanio	Cabezal de quemador de titanio	Cabezal de quemador de titanio
Análisis por llama · Nebulizador	Nebulizador de vidrio de alta eficiencia	Nebulizador de vidrio de alta eficiencia	Nebulizador de vidrio de alta eficiencia
Análisis por llama · Funciones de seguridad	Protección contra presión anormal del gas de llama y del gas auxiliar	Protección contra presión anormal del gas de llama y del gas auxiliar	Protección contra presión anormal del gas de llama y del gas auxiliar
Análisis por horno de grafito · Masa característica	—	Cd ≤0.6pg Cu ≤20pg	Cd ≤0.5pg Cu ≤20pg
Análisis por horno de grafito · Límite de detección	—	Cd ≤1.0pg Cu ≤25pg	Cd ≤0.8pg Cu ≤25pg
Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)	—	≤3%	≤2.5%
Análisis por horno de grafito · Rango de temperatura del horno de grafito	—	Temperatura ambiente~3000°C	Temperatura ambiente~3000°C
Análisis por horno de grafito · Velocidad de calentamiento	—	Máximo 2000°C/s	Máximo 2000°C/s
Análisis por horno de grafito · Funciones de seguridad	—	Alarmas de flujo de agua de refrigeración, presión del gas protector, temperatura del cuerpo del horno, temperatura de la fuente de alimentación e instalación del tubo de grafito	Alarmas de flujo de agua de refrigeración, presión del gas protector, temperatura del cuerpo del horno, temperatura de la fuente de alimentación e instalación del tubo de grafito
Procesamiento de datos · Método de cálculo de concentración	Método de curva estándar(6 métodos de ajuste lineales y no lineales), método de adición estándar, método de interpolación	Método de curva estándar(6 métodos de ajuste lineales y no lineales), método de adición estándar, método de interpolación	Método de curva estándar(6 métodos de ajuste lineales y no lineales), método de adición estándar, método de interpolación
Procesamiento de datos · Número de mediciones repetidas	1~30 veces; calcula y entrega el promedio, la desviación estándar y la desviación estándar relativa de la absorbancia y de la concentración	1~30 veces; calcula y entrega el promedio, la desviación estándar y la desviación estándar relativa de la absorbancia y de la concentración	1~30 veces; calcula y entrega el promedio, la desviación estándar y la desviación estándar relativa de la absorbancia y de la concentración

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	±0.15nm - Sistema de llama B2-01-012040.1	±0.2nm - Sistema integrado de llama y GFAA B2-01-012040.2	±0.15nm - Sistema integrado de llama y GFAA B2-01-012040.3
Accesorio estándar	Lámpara de elemento(Cu*1), compresor de aire libre de aceite, software, memoria USB	Lámpara de elemento(Cu*1, Cd*1), compresor de aire libre de aceite, software, memoria USB, tubo de grafito*5, pipeta*1(5~50µl), punta de pipeta*1000(200µl)	Lámpara de elemento(Cu*1, Cd*1), compresor de aire libre de aceite, software, memoria USB, tubo de grafito*5, pipeta*1(5~50µl), punta de pipeta*1000(200µl)
Accesorio opcional	Llama de alta temperatura enriquecida con oxígeno, generador de hidruros, software de pista de auditoría, automuestreador de llama	Llama de alta temperatura enriquecida con oxígeno, generador de hidruros, software de pista de auditoría, enfriador recirculante, automuestreador de horno de grafito, automuestreador de llama	Llama de alta temperatura enriquecida con oxígeno, generador de hidruros, software de pista de auditoría, enfriador recirculante, automuestreador de horno de grafito, automuestreador de llama
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	830*650*560mm	830*650*560mm	830*650*560mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	1010*780*830mm	1010*780*830mm	1010*780*830mm
Peso neto	85kg	120kg	125kg
Peso bruto	135kg	183kg	183kg

Aplicaciones

1. Confirme el rango espectral

Compare las longitudes de onda de los elementos que debe medir con el rango de longitud de onda y con los anchos de banda espectrales disponibles.

- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: No aplica
  - **Sistema óptico · Rango de longitud de onda**: 185~900nm
  - **Sistema óptico · Ancho de banda espectral**: 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm
- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: ≤3%
  - **Sistema óptico · Rango de longitud de onda**: 185~900nm
  - **Sistema óptico · Ancho de banda espectral**: 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm
- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: ≤2.5%
  - **Sistema óptico · Rango de longitud de onda**: 185~900nm
  - **Sistema óptico · Ancho de banda espectral**: 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2.0nm

2. Revise el nivel de detección requerido

Compare la concentración que espera analizar con el límite de detección y con la repetibilidad del método de llama de cada versión.

- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: No aplica
  - **Análisis por llama · Límite de detección**: Método de llama para Cu: ≤0.004µg/mL
  - **Análisis por llama · Repetibilidad**: Método de llama para Cu: ≤0.5%
- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: ≤3%
  - **Análisis por llama · Límite de detección**: Método de llama para Cu: ≤0.006µg/mL
  - **Análisis por llama · Repetibilidad**: Método de llama para Cu: ≤0.6%
- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: ≤2.5%
  - **Análisis por llama · Límite de detección**: Método de llama para Cu: ≤0.004µg/mL
  - **Análisis por llama · Repetibilidad**: Método de llama para Cu: ≤0.5%

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica sea compatible y que la mesa de trabajo admita las dimensiones externas del equipo.

- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: No aplica

  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 830*650*560mm
- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: ≤3%
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 830*650*560mm
- **Análisis por horno de grafito · Repetibilidad(Cd)**: ≤2.5%
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 830*650*560mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización